# COLOR LASER DISPLAY

Patent number:

JP2001264662

**Publication date:** 

2001-09-26

Inventor:

**OKAZAKI YOJI** 

Applicant:

**FUJI PHOTO FILM CO LTD** 

**Classification:** 

- international: G02B23/00; G02B26/08; G02B26/10; G03B21/00;

G09F13/00; G09G3/34; H01S3/091; H01S3/094; H01S5/183; H01S5/323; G02B23/00; G02B26/08; G02B26/10; G03B21/00; G09F13/00; G09G3/34; H01S3/091; H01S3/094; H01S5/00; (IPC1-7): G02B26/10; H01S3/094; H01S5/183; H01S5/323

- european:

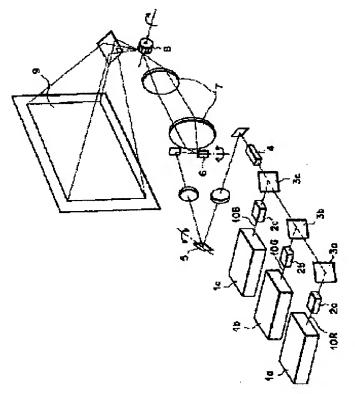
Application number: JP20000073234 20000316 Priority number(s): JP20000073234 20000316 Also published as:

US6764183 (B2) US2001022566 (A1)

Report a data error here

## Abstract of JP2001264662

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize the miniaturization, making high powerfull, and making noiseless in a color laser display. SOLUTION: The color laser display is provided with a red laser light source 1a to emit a red laser beam 10R, a green laser light source 1b to emit a green laser beam 10G, a blue laser light source 1c to emit a blue laser beam 10B, a modulation means 2a, 2b, and 2c to modulate the laser beams 10R, 10G and 10B of each color based on each color picture signal, a screen 9 to display each color and a means 6 and 8 to make the laser beams 10R, 10G, and 10B of each color scan in the shape of a two dimentional on the screen 9. A fiber laser having configuration to excit fiber with a core to which Pr3+ is added by a GaN base semiconductor laser is used as at least one among the red laser light source 1a, the green laser light source 1b and the blue laser light source 1c.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-264662

(P2001-264662A)

(43)公開日 平成13年9月26日(2001.9.26)

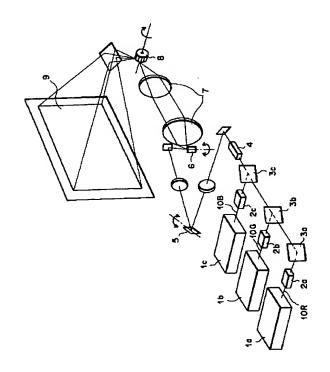
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FI	テーマコード(参考)
G 0 2 B	26/10	BW3/1017 · 3	G 0 2 B 26/10	C 2H045
GU Z B	20/10		G 0 2 B 20/10	B 5F072
Н018	•		H01S 5/183	5 F 0 7 3
	5/183		5/323	
	5/323		3/094	S
			審查請求 未請求 請求項	質の数14 OL (全 10 頁)
(21)出願番号	<b></b>	特願2000-73234(P2000-73234)	(71)出願人 000005201	
			富士写真フイル	<b>/</b>
(22)出顧日		平成12年3月16日(2000.3.16) 神奈川県南足柄市中沼210番地		市中沼210番地
			(72)発明者 岡崎 洋二	
			神奈川県足柄上	郡開成町宮台798番地 富
			士写真フイルム	
			(74)代理人 100073184	
			(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	征史 (外1名)
			Fターム(参考) 2H045 AA01	
				7 AK06 JJ01 JJ04 KK05
				5 MMO3 PPO7 RRO3 YY20
				3 AA74 AB17 AB28 BA09
				7 CA14 CB02 DA05 DA22
			EAOS	5 EA24 EA27 FA25

# (54) 【発明の名称】 カラーレーザディスプレイ

### (57)【要約】

【課題】カラーレーザディスプレイにおいて、小型化、 高出力化、低ノイズ化を実現する。

【解決手段】 赤色レーザ光10Rを発する赤色レーザ光源1 aと、緑色レーザ光10Gを発する緑色レーザ光源1 bと、青色レーザ光10Bを発する青色レーザ光源1 c と、各色レーザ光10R、10G、10Bを各色画像信号に基づいて変調する変調手段2 a、2 b、2 cと、各色を表示するスクリーン9と、各色レーザ光10R、10G、10Bをスクリーン9上において2次元状に走査させる手段6 および8とを備えてなるカラーレーザディスプレイにおいて、赤色レーザ光源1 a、緑色レーザ光源1 bおよび青色レーザ光源1 c のうちの少なくとも1 つとして、P r³ + が添加されたコアを持つファイバーをG a N系半導体レーザによって励起する構成を有するファイバーレーザを用いる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項 1 】 赤色レーザ光を発する赤色レーザ光源 と.

緑色レーザ光を発する緑色レーザ光源と、

青色レーザ光を発する青色レーザ光源と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を各色画像信号に基づいて変調する変調手段と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を 受けて各色を表示するスクリーンと、

前記各色レーザ光による像を前記スクリーン上に投影す 10 る手段とを備えてなるカラーレーザディスプレイにおいて、

前記赤色レーザ光源、緑色レーザ光源および青色レーザ 光源のうちの少なくとも1つとして、Pr³+が添加さ れた固体レーザ結晶をGaN系半導体レーザによって励 起する構成を有する半導体レーザ励起固体レーザが用い られたことを特徴とするカラーレーザディスプレイ。

【請求項2】 前記半導体レーザ励起固体レーザが、

 $^3$  P。  $\rightarrow$   $^3$  F<sub>2</sub> もしくは  $^3$  P。  $\rightarrow$   $^3$  H。 の遷移によって600  $\sim$  660 n m の波長領域のレーザ光を 20 発振させるものであり、この半導体レーザ励起固体レーザが前記赤色レーザ光源として用いられていることを特徴とする請求項  $^1$  記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項3】 前記半導体レーザ励起固体レーザが、

<sup>3</sup> P<sub>1</sub> → <sup>3</sup> H<sub>5</sub> の遷移によって515 ~555 nmの 波長領域のレーザ光を発振させるものであり、この半導 体レーザ励起固体レーザが前記緑色レーザ光源として用 いられていることを特徴とする請求項1または2記載の カラーレーザディスプレイ。

【請求項4】 前記半導体レーザ励起固体レーザが、

<sup>3</sup> P。 → <sup>3</sup> H。の遷移によって465 ~495 nmの 波長領域のレーザ光を発振させるものであり、この半導 体レーザ励起固体レーザが前記青色レーザ光源として用 いられていることを特徴とする請求項1から3いずれか 1項記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項5】 赤色レーザ光を発する赤色レーザ光源と、

緑色レーザ光を発する緑色レーザ光源と、

青色レーザ光を発する青色レーザ光源と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を 40 各色画像信号に基づいて変調する変調手段と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を 受けて各色を表示するスクリーンと、

前記各色レーザ光による像を前記スクリーン上に投影する手段とを備えてなるカラーレーザディスプレイにおいて、

前記赤色レーザ光源、緑色レーザ光源および青色レーザ 光源のうちの少なくとも1つとして、Pr³ + が添加さ れたコアを持つファイバーをGaN系半導体レーザによって励起する構成を有するファイバーレーザが用いられ 50

たことを特徴とするカラーレーザディスプレイ。

【請求項6 】 前記ファイバーレーザが、  $^3$  P。  $\rightarrow$   $^3$  F  $_2$  もしくは  $^3$  P。  $\rightarrow$   $^3$  H。 の遷移によって600  $\sim$ 660 n mの波長領域のレーザ光を発振させるものであり、このファイバーレーザが前記赤色レーザ光源として用いられていることを特徴とする請求項  $^5$  記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項7】 前記ファイバーレーザが、 <sup>3</sup> P<sub>1</sub> → <sup>3</sup> H<sub>5</sub> の遷移によって515 ~555 nmの波長領域のレーザ光を発振させるものであり、このファイバーレーザが前記緑色レーザ光源として用いられていることを特徴とする請求項5または6記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項8】 前記ファイバーレーザが、 <sup>3</sup> P。 → <sup>3</sup> H。 の遷移によって465 ~495 nmの波長領域のレーザ光を発振させるものであり、このファイバーレーザが前記青色レーザ光源として用いられていることを特徴とする請求項5から7いずれか1項記載のカラーレーザディスプレイ。

0 【請求項9】 赤色レーザ光を発する赤色レーザ光源

緑色レーザ光を発する緑色レーザ光源と、

青色レーザ光を発する青色レーザ光源と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を 各色画像信号に基づいて変調する変調手段と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を 受けて各色を表示するスクリーンと、

前記各色レーザ光による像を前記スクリーン上に投影する手段とを備えてなるカラーレーザディスプレイにおい 30 て、

前記赤色レーザ光源、緑色レーザ光源および青色レーザ 光源のうちの少なくとも1つとして、GaN系半導体を 活性層に用いた半導体レーザ素子からなる励起光源と、 該励起光源により励起されてレーザ発振する面発光型半 導体素子とを備えてなる半導体レーザ装置が用いられた ととを特徴とするカラーレーザディスプレイ。

【請求項10】 前記半導体レーザ装置がInGaAl PまたはInGaPからなる活性層を有する面発光型半 導体素子を備えたものであり、

40 この半導体レーザ装置が前記赤色レーザ光源として用いられていることを特徴とする請求項9記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項11】 前記半導体レーザ装置がInGaNからなる活性層を有する面発光型半導体素子を備えたものであり、

この半導体レーザ装置が前記緑色レーザ光源および/または青色レーザ光源として用いられていることを特徴とする請求項9または10記載のカラーレーザディスプレイ。

0 【請求項12】 前記半導体レーザ装置の面発光型半導

2

体素子が、GaN、GaNAsまたはInGaNAsか らなる活性層を有するものであることを特徴とする請求 項9記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項13】 前記半導体レーザ装置の半導体レーザ 素子が、InGaN、GaNAsまたはInGaNAs からなる活性層を有するものであることを特徴とする請 求項9から12いずれか1項記載のカラーレーザディス プレイ。

【請求項14】 前記半導体レーザ装置の半導体レーザ 素子が、5μm以上のストライブ幅を有するものである 10 ΗG固体レーザをレーザディスプレイの光源に用いた場 ことを特徴とする請求項9から13いずれか1項記載の カラーレーザディスプレイ。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、スクリーンを3色 レーザ光で走査する方式のカラーレーザディスプレイに 関し、特に詳細には、レーザ光源として、Pr³+が添 加された固体レーザ結晶を用いる半導体レーザ励起固体 レーザや、Pr³ + が添加されたコアを持つファイバー を用いるファイバーレーザや、さらにはGaN系半導体 20 レーザ素子により面発光型半導体素子を励起する構成を 有する半導体レーザ装置が用いられたカラーレーザディ スプレイに関するものである。

### [0002]

【従来の技術】従来より、赤色光、緑色光および青色光 を受けて各色を表示するスクリーンを、各色画像信号で 変調されたレーザ光で走査してそこに画像を投影する方 式のカラーレーザディスプレイや、レーザ光を空間変調 素子により変調して得られる画像をプロジェクション光 学系によってスクリーンに投影する方式のカラーレーザ 30 ディスプレイが知られている。この種のカラーレーザデ ィスプレイにおいては、高輝度化のために、出力が₩ (ワット) クラスのレーザ光源が必要とされている。そ こで従来はレーザ光源として、高出力のAr+ガスレー ザやKr+ ガスレーザ等が使用されてきた。しかし、ガ スレーザ光源は、一般にエネルギー変換効率が0.1%程 度と低く、また水冷機構が必要であるため、装置が大型 化し、コストが非常に高いという問題があった。

【0003】そこで近年、1997年12月発行のLaser Forc us World p.52に示さるように、可視の短波長レーザ光 源として半導体レーザ励起SHG(第2髙調波発生)固 体レーザが使用され始めた。例えば、発振波長が1064n mの半導体レーザ励起固体レーザを用いた532nmの緑 色波長を発するYAGレーザでは、ガスレーザよりもエ ネルギー変換効率が高いものが得られている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した半導 体レーザ励起SHG固体レーザは高出力化に伴い、レー ザ光に縦モード競合というノイズが発生することが知ら れている。例えば、1998年5月発行のLaser Forcus Wor 50 ーザ光および青色レーザ光を各色画像信号に基づいて変

1d p.243には、青色、緑色固体レーザではノイズが3% 以下であるのに対し、赤色固体レーザでは50%ものノイ ズが発生するということが記載されている。

【0005】これらの縦モードを制御するために、例え ばエタロンを波長選択素子として挿入することも考えら れる。しかしそうした場合は、完全な単一モード発振を 実現するにはロスが大きすぎ、その結果、髙出力が得ら れなくなり、レーザディスプレイを高輝度化できないと いう問題が発生する。したがって、半導体レーザ励起S 合、小型化という点では改善されるが、高効率化、性能 およびコストの点で多くの問題点が残されている。

【0006】本発明は上記事情に鑑みて、小型化および 高効率化が可能で、かつ低ノイズのカラーレーザディス プレイを提供することを目的とするものである。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明による第1のカラ ーレーザディスプレイは、赤色レーザ光を発する赤色レ ーザ光源と、緑色レーザ光を発する緑色レーザ光源と、 青色レーザ光を発する青色レーザ光源と、前記赤色レー ザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を各色画像信号 に基づいて変調する変調手段と、前記赤色レーザ光、緑 色レーザ光および青色レーザ光を受けて各色を表示する スクリーンと、前記各色レーザ光による像を前記スクリ ーン上に投影する手段とを備えてなるカラーレーザディ スプレイにおいて、前記赤色レーザ光源、緑色レーザ光 源および青色レーザ光源のうちの少なくとも1つとし て、Pr³ + が添加された固体レーザ結晶をGaN系半 導体レーザによって励起する構成を有する半導体レーザ 励起固体レーザが用いられたことを特徴とするものであ

【0008】なお上記構成を有する第1のカラーレーザ ディスプレイにおいて、赤色レーザ光源としては、  $P_0 \rightarrow {}^3F_2$  50<td  $^3P_0 \rightarrow {}^3H_6$  O遷移によって600 ~660 nmの波長領域のレーザ光を発 振させる半導体レーザ励起固体レーザを好適に用いるこ とができる。

【0009】また緑色レーザ光源としては、 P1 → <sup>3</sup> H<sub>5</sub> の遷移によって515 ~555 n mの波長領域 40 のレーザ光を発振させる半導体レーザ励起固体レーザを 好適に用いることができる。

【0010】そして青色レーザ光源としては、 。 → <sup>3</sup> H<sub>4</sub> の遷移によって465~495 nmの波長 領域のレーザ光を発振させる半導体レーザ励起固体レー ザを好適に用いることができる。

【0011】また本発明による第2のカラーレーザディ スプレイは、赤色レーザ光を発する赤色レーザ光源と、 緑色レーザ光を発する緑色レーザ光源と、青色レーザ光 を発する青色レーザ光源と、前記赤色レーザ光、緑色レ

調する変調手段と、前記赤色レーザ光、緑色レーザ光お よび青色レーザ光を受けて各色を表示するスクリーン と、前記各色レーザ光による像を前記スクリーン上に投 影する手段とを備えてなるカラーレーザディスプレイに おいて、前記赤色レーザ光源、緑色レーザ光源および青 色レーザ光源のうちの少なくとも1つとして、Pr3+ が添加されたコアを持つファイバーをGaN系半導体レ ーザによって励起する構成を有するファイバーレーザが 用いられたことを特徴とするものである。

【0012】上記構成を有する第2のカラーレーザディ 10 スプレイにおいて、赤色レーザ光源としては、 3 P 。  $\rightarrow$   $^3$   $F_2$  もしくは  $^3$   $P_0$   $\rightarrow$   $^3$   $H_6$  の遷 移によって600~660 nmの波長領域のレーザ光を発振 させるファイバーレーザを好適に用いることができる。 【0013】また緑色レーザ光源としては、 3 P<sub>1</sub> → <sup>3</sup> H<sub>6</sub> の遷移によって515 ~555 nmの波長領域 のレーザ光を発振させるファイバーレーザを好適に用い るととができる。

【0014】そして青色レーザ光源としては、 3 P 。 → ³ H<sub>4</sub> の遷移によって465~495 nmの波長 領域のレーザ光を発振させるファイバーレーザを好適に 用いることができる。

【0015】また本発明による第3のカラーレーザディ スプレイは、赤色レーザ光を発する赤色レーザ光源と、 緑色レーザ光を発する緑色レーザ光源と、青色レーザ光 を発する青色レーザ光源と、前記赤色レーザ光、緑色レ ーザ光および青色レーザ光を各色画像信号に基づいて変 調する変調手段と、前記赤色レーザ光、緑色レーザ光お よび青色レーザ光を受けて各色を表示するスクリーン と、前記各色レーザ光による像を前記スクリーン上に投 30 影する手段とを備えてなるカラーレーザディスプレイに おいて、前記赤色レーザ光源、緑色レーザ光源および青 色レーザ光源のうちの少なくとも1つとして、GaN系 半導体を活性層に用いた半導体レーザ素子からなる励起 光源と、該励起光源により励起されてレーザ発振する面 発光型半導体素子とを備えてなる半導体レーザ装置が用 いられたことを特徴とするものである。

【0016】上記構成を有する第3のカラーレーザディ スプレイにおいて、赤色レーザ光源としては、InGa AlPまたはInGaPからなる活性層を有する面発光 40 置と比べて高効率化も実現できる。 型半導体素子を備えた半導体レーザ装置を好適に用いる ことができる。

【0017】またこの第3のカラーレーザディスプレイ において、緑色レーザ光源や青色レーザ光源としては、 InGaNからなる活性層を有する面発光型半導体素子 を備えた半導体レーザ装置を好適に用いることができ

【0018】さらに上記半導体レーザ装置としては、G aN、GaNAsまたはInGaNAsからなる活性層 ることができる。

【0019】一方、上記半導体レーザ装置の励起光源で ある半導体レーザ素子としては、InGaN、GaNA sまたはInGaNAsからなる活性層を有するものを 好適に用いることができる。またこの半導体レーザ素子 としては、5µm以上のストライプ幅を有する、いわゆ る幅広ストライプタイプのものを用いることが望まし

[0020]

【発明の効果】本発明のカラーレーザディスプレイは、 Pr³ + が添加された固体レーザ結晶を用いる半導体レ ーザ励起固体レーザや、Pr³+ が添加されたコアを持 つファイバーを用いるファイバーレーザや、さらにはG a N系半導体レーザ素子により面発光型半導体素子を励 起する構成を有する半導体レーザ装置を赤色レーザ光 源、緑色レーザ光源あるいは青色レーザ光源として用 い、それらから発せられた赤色レーザ光、緑色レーザ光 および青色レーザ光を各色画像信号に基づいて変調し て、それらの光による像をスクリーン上に投影させる構 成としたので、このスクリーンに上記各色画像信号が担 持するカラー画像を表示することができる。

【0021】そして、赤色レーザ光源、緑色レーザ光源 あるいは青色レーザ光源として用いる上述の半導体レー ザ励起固体レーザ、ファイバーレーザおよび半導体レー ザ装置は、従来装置で用いられているガスレーザのよう に水冷機構は必要ないため、本発明のカラーレーザディ スプレイは従来装置と比べて十分な小型化が可能であ り、部品点数が減ることによりコストダウンの効果も得 られる。また、前述した半導体レーザ励起SHG固体レ ーザを光源として用いる場合と比較しても、光波長変換 素子やエタロン等の縦モード制御素子を用いる必要が無 い分、部品点数減によるコストダウンの効果が得られ

【0022】また、上記半導体レーザ励起SHG固体レ ーザの光-光効率は一般に10~20%程度であるのに対 し、本発明で用いている半導体レーザ励起固体レーザ、 ファイバーレーザおよび半導体レーザ装置のそれは一般 に30~50%程度に達するので、本発明によれば、半導体 レーザ励起SHG固体レーザを光源として用いる従来装

【0023】また、上述の半導体レーザ励起固体レー ザ、ファイバーレーザおよび半導体レーザ装置は、半導 体レーザ励起SHG固体レーザのように所望波長を得る ために光波長変換素子を用いるものではないから、波長 変換に伴う縦モード競合ノイズの発生を招くことがな く、よって、ノイズ量を例えば1%未満程度に抑えるこ とができる。

【0024】また本発明のカラーレーザディスプレイに おいて励起用に用いているGaN系半導体レーザは、そ を有する面発光型半導体素子を備えたものも好適に用い 50 の他のGaAs系半導体レーザ等と比べるとCOD値

6

(端面破壊時の最大光出力)が非常に高いことから高出 力化が可能である。それにより本発明のカラーレーザデ ィスプレイにおいては、高輝度の画像を表示することが できる。

【0025】それに加えて、特に本発明の第2のカラー レーザディスプレイで用いるファイバーレーザは、熱レ ンズ等の問題が無いことからより著しい高出力化が可能 である。そとでとの第2のカラーレーザディスプレイに おいては、より高輝度の画像を表示することができる。 【0026】また本発明のカラーレーザディスプレイ は、励起用のGaN系半導体レーザを直接変調して変調 光を得ることができるという利点も有する。

#### [0027]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施の形態を詳細に説明する。図1は、本発明の第1の実 施の形態であるカラーレーザディスプレイを示すもので ある。

【0028】図示の通りこのカラーレーザディスプレイ は、赤色レーザ光10Rを発する赤色レーザ光源1aと、 緑色レーザ光10Gを発する緑色レーザ光源1 b と、青色 20 レーザ光10Bを発する青色レーザ光源 1 c と、赤色レー ザ光10Rを赤色画像信号に基づいて変調する光変調器2 aと、緑色レーザ光10Gを緑色画像信号に基づいて変調 する光変調器2 b と、青色レーザ光10Bを青色画像信号 に基づいて変調する光変調器2 c とを有している。

【0029】また、変調を受けた赤色レーザ光10Rはミ ラー3aで反射した後ダイクロイックミラー3bおよび 3 cを透過し、変調を受けた緑色レーザ光10Gはダイク ロイックミラー3bで反射した後ダイクロイックミラー 3 cを透過し、そして変調を受けた青色レーザ光10Bは 30 ダイクロイックミラー3cで反射して、互いに1本のビ ームに合波されるようになっている。

【0030】これらの赤色レーザ光10R、緑色レーザ光 10Gおよび青色レーザ光10Bは電気光学光偏向器4に通 されてラスターのピッチむら補正を受けた後、ウォブリ ング用ガルバノメータ5でウォブリングを受け、ガルバ ノメーター6により垂直走査のために反射偏向される。 次いで赤色レーザ光10R、緑色レーザ光10Gおよび青色 レーザ光10Bはリレーレンズ7で伝達および集光され、 回転多面鏡8により水平走査のために反射偏向される。 【0031】以上のように垂直走査用ガルバノメーター 6 および水平走査用回転多面鏡8 により反射偏向された 赤色レーザ光10R、緑色レーザ光10Gおよび青色レーザ 光10Bは、スクリーン9上を2次元的に走査する。スク リーン9は、適当な基材の表面に白色塗料や拡散材等を 塗布あるいは混入させてなるものであり、赤色レーザ光 10R、緑色レーザ光10Gおよび青色レーザ光10Bの照射 を受けると、それぞれ赤色光、緑色光および青色光を拡 散反射させる。

び青色画像信号に基づいて変調されている赤色レーザ光 10R、緑色レーザ光10Gおよび青色レーザ光10Bが上記 スクリーン9上を2次元的に走査することにより、この スクリーン9上に上記3つの画像信号が担持しているカ ラー画像が投影される。なおスクリーン9として、透過 型のものを用いることも可能である。

【0033】なお本実施形態においては、各色レーザ光 をスクリーン上で2次元走査させて画像を投影する方式 を採用したが、各色レーザ光を液晶パネルやDMD(デ ジタル・マイクロミラー・デバイス)等の空間変調素子 を用いて変調し、それによって得られる画像をプロジェ クション光学系によってスクリーン上に投影する方式を 採用してもよい。

【0034】次に、赤色レーザ光源1a、緑色レーザ光 源1bおよび青色レーザ光源1cについて詳しく説明す る。本実施形態においては、これらの光源として、Pr <sup>3</sup> † が添加されたコアを持つファイバーをGaN系半導 体レーザによって励起する構成を有するファイバーレー ザが用いられている。

【0035】図2は、これらのレーザ光源のうち、赤色 レーザ光源1aとしてのファイバーレーザを示すもので ある。このファイバーレーザは、励起光としてのレーザ 光110をそれぞれ発する2個の半導体レーザ111と、発散 光であるレーザ光110をそれぞれ平行光化する2個のコ リメーターレンズ112と、2本のレーザ光110を偏光合波 する偏光ビームスプリッタ113と、この偏光ビームスプ リッタ113で1本に合波されたレーザ光110を集光する集 光レンズ114と、Pェ3 + がドープされたコアを持つフ ァイバー115とからなる。

【0036】半導体レーザ111としては、発振波長440n mのブロードエリア型高出力 In Ga N系半導体レーザ が用いられている。本例における半導体レーザ111の各 々の出力は2♥であり、したがって合波されたレーザ光 110は出力4 Wとなる。

【0037】またファイバー115は図3に断面形状を示 すように、断面正円形のコア120と、その外側に配され た断面ほぼ矩形の第1クラッド121と、その外側に配さ れた断面正円形の第2クラッド122とからなる。コア120 はPr³ + が例えば0.2%ドープされたZr系弗化物ガ 40 ラス、例えばZBLANP(ZrF4-BaF2-La F<sub>3</sub> -AlF<sub>3</sub> -AlF<sub>3</sub> -NaF-PbF<sub>2</sub>)からな り、第1クラッド121は一例としてZBLAN(ZrF 4-BaF2-LaF3-AlF3-NaF)からな り、第2クラッド122は一例としてポリマーからなる。 【0038】なおコア120は上記 ZBLANPに限ら ず、石英ガラスや、ZBLANや、In/Ga系弗化物 ガラス、例えばIGPZCLすなわち(InF。-Ga F<sub>3</sub> -LaF<sub>3</sub>) - (PbF<sub>2</sub> -ZnF<sub>2</sub>) -CdF等 を用いて形成されてもよい。

【0032】それぞれ赤色画像信号、緑色画像信号およ 50 【0039】集光レンズ114により集光された波長440n

mのレーザ光110は、上記ファイバー115の第1クラッド 121に入力され、そこを導波モードで伝搬する。つまり この第1クラッド121は、励起光であるレーザ光110公対 してはコアとして作用する。

【0040】レーザ光110は、とのように伝搬する間にコア120の部分も通過する。コア120においては、入射したレーザ光110により $\Pr^{s+}$ が励起されて、  $^{s}$   $\Pr$  の遷移によって650nmの蛍光が生じる。この蛍光はコア120を導波モードで伝搬する。

【0041】 ZBLANPからなるコア120においては、その他に、 <sup>3</sup> P<sub>1</sub> → <sup>3</sup> H<sub>5</sub> の遷移によって波長520nmの蛍光、 <sup>3</sup> P<sub>6</sub> → <sup>3</sup> F<sub>2</sub> の遷移によって波長605nmの蛍光、 <sup>3</sup> P<sub>6</sub> → <sup>3</sup> H<sub>4</sub> の遷移によって波長491 nmの蛍光が発生し得る。

【0042】そとで、ファイバー115の入射端面115aには、波長650nmに対してHR(高反射)、波長520nm、605nm、491nm並びに励起光波長440nmに対してAR(無反射)となる特性のコートが施され、ファイバー115の出射端面115bには、波長650nmの光を1%だけ透過させるコートが施されている。

【0043】それにより、上記波長650 nmの蛍光はファイバー115の両端面115a、115b間で共振して、レーザ発振を引き起こす。こうして波長650 nmの赤色レーザ光10Rが発生し、この赤色レーザ光10Rがファイバー115の出射端面115bから前方に出射する。

【0044】なお本例では、赤色レーザ光10Rはコア12 0においてシングルモードで、一方励起光であるレーザ光110は第1クラッド121においてマルチモードで伝搬する構成とされている。それにより、高出力のブロードエリア型半導体レーザ111を励起光源に適用して、レーザ光110を高い結合効率でファイバー115に入力させることが可能となっている。

【0045】それに加えて、第1クラッド121の断面形状がほぼ矩形とされているため、レーザ光110がクラッド断面内で不規則な反射経路を辿り、コア120公入射する確率が高められている。

【0046】以上により、高い発振効率が確保され、高 出力の赤色レーザ光10Rが得られるようになる。本実施 形態では、赤色レーザ光10Rの出力は2Wである。

【0047】次に緑色レーザ光源1bについて説明する。この緑色レーザ光源1bは、上記赤色レーザ光源1aとほぼ等しい基本構成を有し、上記ファイバー115の両端面のコートを変えた形のファイバーを用いることにより、そこから波長520nmの緑色レーザ光10Gを射出するものである。励起光源としては上記と同様に発振波長440nm、出力2Wのブロードエリア型高出力InGaN系半導体レーザが2個用いられ、したがって合波されたレーザ光の出力は4Wである。このとき、緑色レーザ光10Gの出力は1Wである。

【0048】次に青色レーザ光源1cについて説明す

る。この青色レーザ光源 1 cも、上記赤色レーザ光源 1 aとほぼ等しい基本構成を有し、上記ファイバー115の両端面のコートを変えた形のファイバーを用いることにより、そこから波長491n mの青色レーザ光10Bを射出するものである。

【0049】ただしこの場合の励起光源としては、青色レーザ光の発振の効率が低いことから、上記と同様に発振波長440nm、出力2Wのブロードエリア型高出力InGaN系半導体レーザを2個用いてなる出力4Wの偏光合波ユニットを2つ組み合わせることにより、出力8Wの励起光を得ている。

【0050】図4は、上記2つの偏光合波ユニットを組み合わせた構成を示している。図示の通り本例では、各偏光合波ユニット130を略Y字状のファイバー131の分岐側に結合し、該ファイバー131から出射した発散光状態のレーザ光110をコリメーターレンズ132で平行光化した後、集光レンズ133で集光してファイバー115に入力させている。

【0051】なお、この第1の実施形態におけるように ファイバーレーザを用いる場合は、そこから発せられる 赤色レーザ光10R、緑色レーザ光10Gあるいは青色レーザ光10Bが縦マルチモードのものとなるので、場合によっては、図1に示したウォブリング用ガルバノメータ5 は省いてもよい。

【0052】また、ピッチむら補正を行なう電気光学光 偏向器4の代わりに、シリンドリカルレンズを用いた面 倒れ補正光学系を用いてもよい。一方光変調器2a,2 bおよび2cとしては、例えばAOM(音響光学光変調 器)またはEOM(電気光学光変調器)を用いることが できる。

【0053】次に、本発明の第2の実施形態によるカラーレーザディスプレイについて説明する。この第2の実施の形態のカラーレーザディスプレイは、図1に示した構成と比較すると、ファイバーレーザからなる赤色レーザ光源1a、緑色レーザ光源1b および青色レーザ光源1cに代えて、それぞれ半導体レーザ素子により励起される面発光型半導体素子を備えてなる半導体レーザ装置が各色光源として用いられた点が異なるものである。

【0054】 ここで、それらの半導体レーザ装置のう 40 ち、赤色レーザ光源としての半導体レーザ装置につい て、図5、6および7を参照して説明する。図5はこの 半導体レーザ装置の全体構成を示すものである。また図 6 および7はそれぞれ、この半導体レーザ装置を構成す る半導体レーザ素子74と、面発光型半導体素子39の断面 形状を示している。

【0055】まず、励起用の半導体レーザ素子74について、図6を参照してその製造方法とともに説明する。有機金属気相成長法により、n-GaN(0001)基板61上にn-Ga,-z,Al,N/GaN超格子クラット層62(0<z1<1)、nあるいはi-GaN光導波層

30

11

63. In1-12 Ga12 N (SiF-7) / In1 - , , Ga, , N多重量子井戸活性層64(0<z2<z3< 0.5) 、p-Ga1-25 Al25 Nキャリアブロッキ ング層65 (0<z5<0.5)、nあるいはi-GaN光導波 層66、p-Ga<sub>1</sub>- 、 Al、 N/Ga N超格子クラ ッド層67 (0<z1<1)、p-GaNコンタクト層68を形 成する。

【0056】その上に絶縁膜69を形成し、通常のリソグ ラフィにより100μm程度のストライプの領域の絶縁膜6 9を除去し、p側電極70を形成する。その後、基板の研 磨を行ない、n側電極力を形成し、劈開により共振器を 形成し、高反射コートと低反射コートを施し、チップ化 すると半導体レーザ素子74が完成する。このブロードエ リア型 In GaN系半導体レーザ素子740発振波長は41 0n m、出力は2 Wである。

【0057】次に、面発光型半導体素子39について、図 7を参照してその製造方法とともに説明する。ここで、 後述のλは光励起により発振する波長であり、n

In Alp, Nin Gaalp, Nsioz, N zrozはそれぞれInAlP、InGaAlP、Si O2、ZrO2の発振波長での屈折率である。

【0058】有機金属気相成長法により、GaAs基板 31 LC, Ino. 5 (Ga1-x5Alx5)0. 5 P クラッド層32、Ino. 5 (Ga<sub>1-x2</sub> Al<sub>x2</sub>) 。. s P下部光閉じ込め層33、Ino. s (Ga 1 - x 3 A 1 x 3 ) 0 . 5 P/Ino . 5 (Ga 1-x4A1x4)0.5 P多重量子井戸活性層34、I no. 5 (Ga<sub>1-x2</sub> Al<sub>x2</sub>)<sub>0.5</sub> P下部光閉じ 込め層35、2ペアのIno.s Alo.s P (厚さがλ /4n<sub>1 m A 1 p</sub>)/In<sub>0.5</sub> (Ga<sub>1-x1</sub> A l x 1 ) o . s P (厚さが λ / 4 n l a g a x l p ) 分布 反射膜36(本層は無くてもよい)を積層する。上記組成 は0≤x4<x3≤1、x4<x2<x5≤1、0≤x3<x1≤x2および x3<x5<1を満たすものが望ましい。

【0059】その後、電子ビーム蒸着法等により12ペ アのSiO<sub>2</sub> (厚さがλ/4n<sub>sio2</sub>)/ZrO 2 (厚さが λ / 4 n z , o 2 ) 分布反射膜 37を積層す る。その後基板の研磨を行ない、硫酸系エッチャントで 発光領域のGaAs基板31を除去する。このときIn  $a_{1.5}$  (Ga<sub>1-x5</sub> Al<sub>x5</sub>)  $a_{1.5}$  Pクラッド層32 40 が露出して自動的にエッチングが停止する。その後、乙 rO<sub>2</sub> (厚さがλ/4 n<sub>z</sub>, o<sub>2</sub>)の無反射コート38を 施し、劈開によりチップ化すると面発光型半導体素子39 が完成する。

【0060】上記構成の面発光型半導体素子39の発振波 長帯は、Ino. 5 (Ga1-x4Alx4)o. 5 P 量子井戸活性層より、600nm以上700nm以下の範囲で 制御可能であるが、本例では650nmとしている。

【0061】次に図5を参照して、上記面発光型半導体 素子39およびInGaN系半導体レーザ素子74からなる 50 👢- 👢 4 N層82(0<z4<0.5)、GaN光閉じ込め層8

半導体レーザ装置について説明する。

【0062】との半導体レーザ装置は、励起光源74 と、ヒートシンク43に12ペアのSiO2 (厚さがA/ 4nsio2)/ZrO2 (厚さが入/4nzro2) 分布反射膜37側端面を接着された面発光型半導体素子39 と、出力ミラーである凹面ミラー46と、凹面ミラー46の 凹面と面発光型半導体素子39の分布反射膜37により構成 される外部共振器49と、外部共振器49内に配されて偏光 を制御するブリュースター板45とを備えてなるものであ る。

【0063】なお励起光源74 は、図6に示した出力2 Wのブロードエリア型ⅠnGaN系半導体レーザ素子74 を2個有するとともに、それらから各々発せられた励起 用レーザ光を例えば図2に示したような偏光合波手段に よって合波する構成を備えたものである。したがってと の励起光源74'の出力は4℃である。

【0064】励起光源74°から発せられた波長410nm の励起光47は、レンズ42により面発光型半導体素子39の 半導体層内部に集光される。この励起光47により励起さ れた面発光型半導体素子39が発する光は、外部共振器49 により共振し、発振した波長650nmの赤色レーザ光48 が出力ミラー46から出射する。この赤色レーザ光48は出 力2Wであり、第1の実施形態におけるのと同様に、ス クリーン9(図1参照)を2次元走査するのに利用され る。

【0065】なお面発光型半導体素子39のGaAs基板 31は、波長410n mの励起光47に対して透明ではないの で、面発光型半導体素子39は図5に示すように、サイド から励起される。

【0066】この第2の実施形態では、励起光源74を 構成する半導体レーザ素子74を直接変調することによ り、第1の実施形態で用いられた外部光変調器2aは用 いなくて済み、それにより低コスト化が可能となる。

【0067】次に、緑色レーザ光源および青色レーザ光 源として用いられる半導体レーザ装置について、図8お よび9を参照して説明する。図8はこの半導体レーザ装 置の全体構成を示すものである。また図9は、この半導 体レーザ装置を構成する面発光型半導体素子89の断面形 状を示している。なおこの面発光型半導体素子89を励起 する励起光源74'は、上に説明した赤色レーザ光源で用 いられたものと同じものである。

【0068】以下、面発光型半導体素子について、図9 を参照してその製造方法とともに説明する。ことで、後 述の λ は光励起により発振する波長であり、 n 🗸 🔒 、 ngan nsioz nzroz tenenAlN. GaN、SiO2、ZrO2の発振波長での屈折率であ

【0069】図9に示すように、有機金属気相成長法に より、GaN (0001) 基板81上にA1, Ga

(8)

13

3, In<sub>1</sub> - 12 Ga<sub>12</sub> N/In<sub>1</sub> - 13 Ga<sub>13</sub> N 多重量子井戸活性層84(0<z2<z3<0.5)、G a N光閉 じ込め層85、2ペアのAIN (厚さがλ/4n<sub>AIN</sub>) /GaN (厚さがλ/4ng N) 反射膜86を積層す る。その後、電子ビーム蒸着法により、SiOz(厚さ がλ/4nsio2)/ZrO2 (厚さがλ/4nz ro2)分布膜87を積層する。その後、基板の研磨を行 ない、ZrO<sub>2</sub> (厚さがλ/4nzro<sub>2</sub>)の無反射率 コート88を施し、劈開によりチップ化すると面発光型半 導体素子89が完成する。

【0070】なお、上記多重量子井戸活性層84の井戸数 は、励起光を十分に吸収するため、20ペア以上、より 好ましくは厚く積みすぎてクラックが生じない程度の2 4ペア程度が望ましい。

【0071】上記のようにして作成された面発光型半導 体素子89の発振波長帯は、Inz。Ga1-z。N量子 井戸活性層より、380nmから560nmの範囲で制御可能 であるが、本例で緑色レーザ光源としては520n m、青 色レーザ光源としては450n mとしている。

【0072】次に図8を参照して、上記面発光型半導体 20 素子89および In GaN系半導体レーザ素子74からなる 半導体レーザ装置について説明する。

【0073】図8(a)に示すようにこの半導体レーザ 装置は、励起光源74'と、ヒートシンク106にGaN基 板81とは反対側の分布反射膜87側を接着された面発光型 半導体素子89と、出力ミラーである凹面ミラー105と、 凹面ミラー105の凹面と面発光型半導体素子89の反射ミ ラー86および87により構成される共振器109と、共振器1 09内に配されて偏光を制御するブリュースター板104と を備えてなるものである。

【0074】出力4 Wの励起光源74、から発せられた波 長410n mの励起光107は、レンズ102により面発光型半 導体素子89の半導体層内部に集光される。この励起光10 7により励起された面発光型半導体素子89が発する光 は、共振器109により共振し、発振したレーザ光108が出 力ミラー105から出射する。

【0075】レーザ光108として波長520nmの緑色レー ザ光を得る構成の場合、その出力は1 ♥である。一方、 レーザ光108として波長450nmの青色レーザ光を得る構 成の場合、その出力は2℃である。この緑色あるいは青 40 色のレーザ光108は、第1の実施形態におけるのと同様 に、スクリーン9(図1参照)を2次元走査するのに利

【0076】この場合も、励起光源74'を構成する半導 体レーザ素子74を直接変調することにより、第1の実施 形態で用いられた外部光変調器2b、2cは用いなくて 済み、それにより低コスト化が可能となる。

【0077】なお図8(b)に示すように、励起光源フ 4 から射出された励起光107の入射角度は、戻り光抑制 入射させてもよい。

【0078】また面発光型半導体素子としては、以上説 明したものに限らず、その他GaN、GaNAsまたは InGaNAsからなる活性層を有する面発光型半導体 素子等も好適に用いることができる。一方励起光源とな る半導体レーザ素子も以上説明したものに限らず、その 他GaNAsまたはInGaNAsからなる活性層を有 する半導体レーザ素子等も好適に用いることができる。 【0079】次に、本発明のカラーレーザディスプレイ 10 に用いられ得る半導体レーザ励起固体レーザの例を、図 10を参照して説明する。との半導体レーザ励起固体レ ーザは、励起光としてのレーザ光210を発する半導体レ ーザ211と、発散光であるレーザ光210を集光する集光レ ンズ212と、Pr³ + がドーピングされた固体レーザ媒 質であるLiYF。 結晶(以下、Pr³ + :LiYF 4 結晶と称する)213とを有している。

【0080】以上の各要素211~213はベルチェ素子214 の上に固定されている。またこのベルチェ素子214上に は温度検出用のサーミスタ215が固定され、とのサーミ スタ215の出力は図示しない温度調節回路に入力される ようなっている。そしてこの温度調節回路により、サー ミスタ215の出力に基づいてペルチェ素子214が駆動さ れ、半導体レーザ211、集光レンズ212およびPr³+: LiYF。 結晶213が所定温度に保たれる。

【0081】半導体レーザ211としては、発振波長440 nmのブロードエリア型のInGaN系半導体レーザが 用いられている。またPr³+:LiYF。 結晶213 の光入射面である後方端面213a には、後述する波長479 nmの光を良好に反射させる(反射率99.9%以上)コ 30 ーティングが施され、一方この結晶213の光出射面であ る前方端面213bには、波長479 nmの光を1%だけ透 過させて残余は反射させるコーティングが施されてい

【0082】 In Ga N系半導体レーザ211から発せら れた波長440 n mのレーザ光210は、P r <sup>3 +</sup> : L i Y F。 結晶213の後方端面213aから該結晶213内に入射 する。Pr³+:LiYF。 結晶213は入射したこの レーザ光210℃よってPr³ + が励起され、 ³ P。 → <sup>3</sup> H<sub>4</sub> の遷移によって波長479 n m の光を発す る。との光は上記の通りのコーティングが施されている 結晶端面213a 、213bの間で共振し、レーザ発振を引き 起こす。こうして発生した波長479 nmの青色のレーザ 光216は、Pr³+:LiYF。 結晶213の前方端面21 3b から出射する。

【0083】以上、青色レーザ光を発生させる半導体レ ーザ励起固体レーザの例を説明したが、本発明ではこの ような半導体レーザ励起固体レーザとして、 → <sup>3</sup> F<sub>2</sub> もしくは <sup>3</sup> P<sub>0</sub> → <sup>3</sup> H<sub>0</sub> の遷移によ って600 ~660 nmの波長領域にある赤色レーザ光を発 のために面発光型波長変換素子89に対して角度をつけて 50 振させるものや、 ³P<sub>1</sub> → ³H<sub>5</sub> の遷移によっ

て515  $\sim$ 555 n mの波長領域の緑色レーザ光を発振させるものを用いることも可能である。

15

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態によるカラーレーザ ディスプレイの概略構成図

【図2】図1のカラーレーザディスプレイに用いられたファイバーレーザの概略側面図

【図3】上記ファイバーレーザを構成するファイバーの 断面図

【図4】図1のカラーレーザディスプレイに用いられた 10 別のファイバーレーザの概略側面図

【図5】本発明の第2の実施の形態によるカラーレーザ ディスプレイに用いられた半導体レーザ装置の概略構成 図

【図6】図5の半導体レーザ装置を構成する半導体レー ザ素子の概略断面図

【図7】図5の半導体レーザ装置を構成する面発光型半 導体素子の概略断面図

【図8】本発明の第2の実施の形態によるカラーレーザディスプレイに用いられる別の半導体レーザ装置の概略 20 機成図

【図9】図8の半導体レーザ装置を構成する面発光型半 導体素子の概略断面図

【図10】本発明に用いられる半導体レーザ励起固体レーザの一例を示す概略側面図

【符号の説明】

la 赤色レーザ光源

1 b 緑色レーザ光源

1 c 青色レーザ光源

\*2a、2b、2c 光変調器

4 ピッチむら補正用電気光学光偏向器

5 ウォブリング用ガルバノメータ

6 垂直走査用ガルバノメーター

7 リレーレンズ

8 水平走査用回転多面鏡

9 スクリーン

10R 赤色レーザ光

10G 緑色レーザ光

) 10B 青色レーザ光

39 面発光型半導体素子

48 赤色レーザ光

74 半導体レーザ素子

74' 励起光源

89 面発光型半導体素子

108 緑色または青色レーザ光

110 励起用レーザ光

111 半導体レーザ

11.3 偏光ビームスプリッタ

115 ファイバー

120 コア

121 第1クラッド

122 第2クラッド

130 偏光合波ユニット

131 Y字状のファイバー

210 レーザ光

211 半導体レーザ

213 Pr³+:LiYF4 結晶

k 216 青色レーザ光

【図1】 【図3】

